



## 増田賢一 Kenichi Masuda

### 《NPF担当装置》

- i線露光装置
- マスクアライメント露光装置
- ウェハ圧着機



NPFではフォトリソ関連の装置を担当し、主にi線露光装置で技術代行の仕事をしています。ここに来る前は、半導体メーカーで約9年間フォトリソ関連の仕事をしてきました。

NPFに来たのは2005年6月。当時をふり返ると、取扱うウェハのサイズやプロセスに戸惑ったのを思い出します。量産工場とは違う小さな小片基板に、大型の装置で露光するとは思いませんでした。また研究が進むにつれ、複雑なプログラムの作成依頼や特殊な材料への露光依頼など、数多くの難題もあったように思います。

今ではその経験のお蔭で、チャレンジングなリクエストにも柔軟に対応できるようになりました。今後もユーザーさんとのコミュニケーションを大切に、良好な研究成果が得られるような技術支援を行っていきたいと思います。